



Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas

Szkolenie teoretyczne połączone z warsztatami praktycznymi w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Termin: 05.08.2019 r.

Miejsce: Chodzież

Cena: 650,00 zł netto

Do kogo szkolenie jest skierowane?

Szkolenie skierowane jest dla laboratoriów przygotowujących się do akredytacji metody badawczej oraz laboratoriów posiadających wdrożony system jakości.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Uczestnicy szkolenia nabywają wiedzy i umiejętności w zakresie:

- pomiarów hałasu akustycznego na stanowiskach pracy
- sprawdzenia aparatury pomiarowej
- wyznaczenia wskaźnika narażenia
- określenia niepewności aparatury pomiarowej i niepewności metody badawczej
- walidowania metody badawczej

Warsztaty praktyczne ukierunkowane na Podejście procesowe oraz analizę ryzyk i szans w obszarze środowiska pracy w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 rozszerzają doświadczenie uczestników przez:

- szczegółowe omówienie procesów i ich powiązań oraz przygotowanie „Kart procesu” dla wszystkich zidentyfikowanych procesów
- identyfikację ryzyk i szans oraz ich analizę
- praktyczne wykonanie najistotniejszych ryzyk i szans

Notka o Prelegentach

Andrzej Uzarczyk

Absolwent Politechniki Gdańskiej wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Wieloletni pracownik Laboratorium Badań środowiska pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku i wieloletni wykładowca. Autor publikacji i programów komputerowych z zakresu czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Ewelina Siwek

Wieloletni Kierownik Laboratorium badań środowiskowych. Czynny audytor systemu zarządzania oraz obszaru technicznego w zakresie pobierania oraz badania próbek zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń oraz audytów wewnętrznych. W swojej wieloletniej pracy przez proces akredytacji przeprowadziła od podstaw 5 laboratoriów badawczych, funkcjonujących do dnia dzisiejszego. Przewodnicząca Grupy roboczej ds. materiałów odniesienia substancji czystych i matrycowych utworzonej w GUM.